

(12) NACH DEM VERT... ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Oktober 2004 (21.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/089872 A1(51) Internationale Patentklassifikation?: C07C 217/62,
A61K 31/135, C07C 213/10, A61P 13/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/003567

(22) Internationales Anmeldedatum:
3. April 2004 (03.04.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 15 917.7 8. April 2003 (08.04.2003) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): SCHWARZ PHARMA AG [DE/DE]; Alfred-Nobel-
Strasse 10, 40789 Monheim (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BREITENBACH,
Armin [DE/DE]; Opladener Strasse 108, 40789 Mon-
heim (DE). MEESE, Claus [DE/DE]; Kreuzberger Str.
50, 40789 Monheim (DE). WOLFF, Hans-Michael
[DE/DE]; Richard-Wagner-Strasse 2, 40789 Monheim
(DE). DREWS, Roland [DE/DE]; Ulmenweg 24, 40789
Monheim (DE).(74) Gemeinsamer Vertreter: SCHWARZ PHARMA AG;
Schacht, D., W., Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
(DE).(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

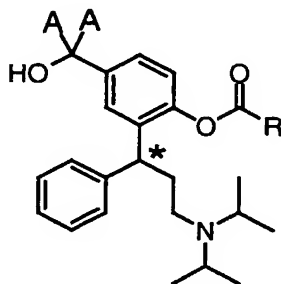
Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die
folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HIGHLY PURE BASES OF 3,3-DIPHENYL PROPYLAMINE MONOESTERS

(54) Bezeichnung: HOCHREINE BASEN VON 3,3-DIPHENYLPROPYLAMINMONOESTERN



(I)

(57) Abstract: The invention relates to a compound
of general formula (I) wherein A represents deuterium
or hydrogen, R represents a group selected from
C₁₋₆ alkyl, C₃₋₁₀ cycloalkyl or phenyl, which can
be substituted by C1-3 alkoxy, fluorine, chlorine,
bromine, iodine, nitro, amino, hydroxyl, oxo,
mercapto or deuterium. The C atom marked with
a * (star) can be present in an (R) configuration,
in an (S)-configuration or a mixture thereof. The
invention is characterised in that the above-mentioned
compounds are free bases with a degree of purity of
more than 97 wt %. The invention also relates to a
method for the production of highly pure compounds

of general formula (I) and to the use thereof in the production of medicaments.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verbindung der allgemeinen Formel (I), wobei A Deuterium oder
Wasserstoff ist, R für eine Gruppe steht, die ausgewählt ist aus C₁₋₆Alkyl, C₃₋₁₀ Cycloalkyl oder Phenyl, die jeweils mit C1-3Alkoxy,
Fluor, Clor, Brom, Iod, Nitro, Amino, Hydroxy, Oxo, Mercapto oder Deuterium substituiert sein kann und wobei das mit *-(Stern)
markierte C-Atom in (R)-Konfiguration, in (S)-konfiguration oder als Mischung davon vorliegen kann, dadurch charakterisiert, dass
die besagte Verbindung als freie Base mit einem Reinheitsgrad von über 97 Gew% vorliegt. Ferner betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Herstellung hochreiner Verbindungen der allgemeinen Formel (I) sowie die Verwendung der hochreinen Verbindungen
zur Herstellung von Arzneimitteln.